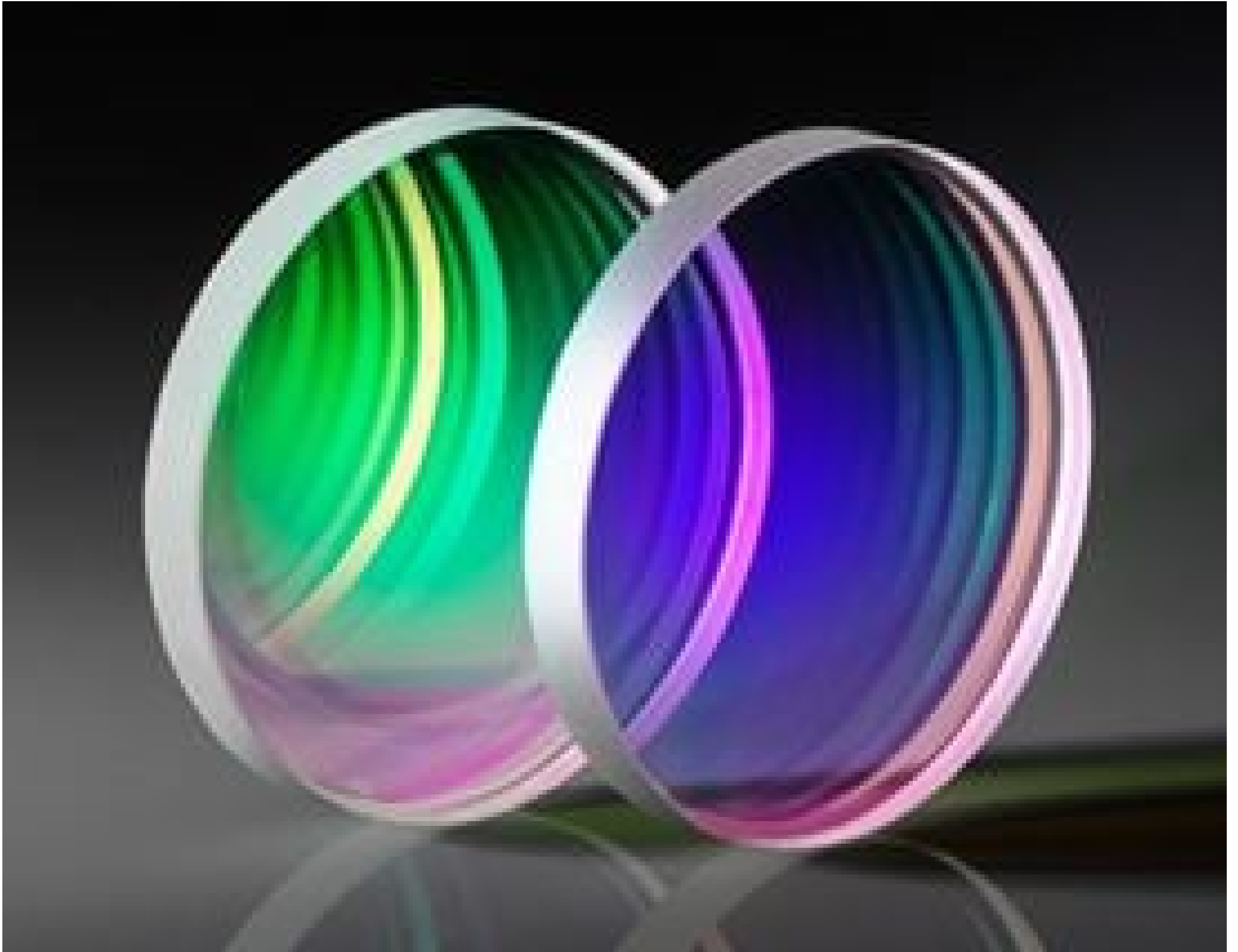


Dichroitischer Filter für EUV/IR, 20-40 nm, 50,8 mm Durchmesser



Extreme Ultraviolet (EUV) Dichroic Filters

Produkt #18-280 **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €5.400⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€5.400,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Dichroic Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

50.80 **Durchmesser (mm):**

5.08 ±0.1 **Dicke (mm):**

Parallelität (Bogenminuten):

<5

Toleranz Größe (mm):

+0.0/-0.2

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):

78

Substrat:

[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung:

Dielectric Multilayer AR

Reflexion (%):

>40

Oberflächenqualität:

20-10

Wellenlängenbereich (nm):

20 - 40

Oberflächengenauigkeit, RMS:

$\lambda/10$ @ 633nm

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Trennen bei der Erzeugung hoher Harmonischer EUV von der NIR-Laserquelle
- Besitzen hohe Zerstörschwelle
- Für Anwendungen zwischen 10 und 40 nm
- Lagernd und verfügbar
- Keine minimale Bestellmenge, keine zusätzlichen Kosten für Beschichtungschargen

Die dichroitischen Filter für extremes Ultraviolett (EUV), auch als Strahlseparatoren bezeichnet, wurden für Anwendungen zur Erzeugung hoher Harmonischer entwickelt und bieten eine gute Trenneffizienz zwischen EUV- und NIR-Wellenlängen. Die Filter bestehen aus Quarzglassubstraten und halten höherer Laserleistung stand als die Strahlseparatoren mit Brewster-Winkel und EUV-Filter. Die dichroitischen EUV-Filter haben eine große Bandbreite von 10 nm bis 40 nm. Zusätzlich zur Erzeugung hoher Harmonischer können die Filter auch in EUV-Anwendungen wie EUV-Lithographie oder EUV-Nanotechnologie, der kohärenten diffraktiven Bildgebung sowie für die Erzeugung von ultrakurzen Attosekunden-Pulsen eingesetzt werden.